中国源光

第13卷 第8期

尿素晶体的氩离子激光倍频

曾永健 邱明新 苏根博 贺友平 黄炳荣(上海市激光技术研究所) (福建物质结构研究所)

提要:报道了以氩离子激光 514.5、496.5 和 488.0nm 三条谱线在尿素晶体的 倍频实验结果,发现由于热效应引起¢角方向的相位失配现象,给出了倍频效率与各 参变量间的关系。

Second harmonic generation with urea crystal by Ar⁺ laser light

Zeng Yongjian, Qiu Mingxin (Shanghai Institute of Laser technology) Su Genbuo, He Youpin, Huang Bingrong (Fujian Institute of Material Structure

Abstract: Characteristics of the second harmonic generation at three lines, 514.5, 496.5, and 488.0nm, with a urea crystal by Ar⁺ laser light is reported in detail for first time. The phase mismatch at azimuthal angle due to thermal effect was found. The dependence of frequency-doubling efficiency upon other parameters is given.

目前,用于紫外波段的非线性晶体很多, 如 KDP、KD*P、ADP 和 KB₅等。 KDP 晶 体在室温下可产生的最短波长是 259 nm, ADP 晶体用温度相位匹配产生的最短波长 是 246 nm,但晶体的工作温度为 $-116^{\circ}C^{(1)}$, 已达到晶体的居里温度以下。[2,3]已报道 用尿素晶体混频获得 212.8 nm 的相干辐射 以及提到 Ar⁺ 激光 488.0 nm 线的倍频产生 紫外相干辐射,但未给出基波功率及倍频光 功率与其他参量的关系。我们用尿素晶体对 Ar⁺ 激光 514.5、496.5 和 488.0 nm 三条谱 线倍频,获得 257.3、248.3 和 244.0 nm 的 连续紫外相干辐射,及有关特性曲线和参 数。

、实验装置

实验装置见图 1。实验中采用第 I 类角 度相位匹配(ee-o)方法。根据尿素 晶体的 折射率^[3],可求得对 514.5 nm 光倍频的相位 匹配角为 62°34′。晶体切割和抛光方法与 ADP 晶体相似。使用的晶体截面为 10×10 mm²,厚度 5 mm。因尿素晶体易潮解,晶体 抛光后,通光面用石英片保护,并用密封胶密 封。

Ar⁺ 激光器为 360 型, 单线输出, 波长可 调。基波光经透镜会聚在晶体中部。由晶体 收稿日期: 1985年4月1日。



出射的光束经双色镜和紫外高通滤光器滤去 剩余的基波后,获得紫外倍频光,由光电二 极管或功率计接收。基波光在倍频前经分束 后由接收器接收,监视其功率。双色镜为45° 紫外高反滤光片。紫外高通滤光器对实验波 段的紫外光透过率为89%,基波光透过率 <10⁻⁵。

二、实验结果

通过调节晶体的相位匹配角,分别获得 了氩离子激光514.5、496.5和488.0nm 三 条谱线的倍频光,波长为257.3,248.3和 244.0nm。实验测量了这三条谱线的相位匹 配角,见表1。表中同时列出由参考文献[3] 给出的折射率计算得到的相位匹配角,两者 相近。存在差别的原因可能是实验晶体折射 率与文献给出的晶体折射率有微小的差别。

实验值	计算值
60°34′ 67°6′ 71°41′	62°34′ 68°52′ 72°53′
4	• 514.5nm + 488.0nm • 496.5nm
/: *	the states
	实验值 60°34′ 67°6′ 71°41′

表1 尿素晶体的相位匹配角

实验测量了晶体对应三条谱线的角度相 位匹配的容许角,如图2所示。实验时聚焦 透镜的焦距为3cm。由图可得出对应514.5, 496.5和488.0nm 三条谱线的容许角半宽 度分别为50′、52′和57′。

通过测量不同的基波光功率时输出的最



. 479 .

大倍频光功率,得到 514.5 nm 光功率小于 1.6W,488.0 nm 光功率小于 0.5W 时倍频 光功率与基波光功率的平方成线性关系,如 图 3 所示。在 514.5 nm 光功率为 1.6W 时,得到的倍频光功率为 0.4 mW,在 488.0 nm 光功率为 0.5W 时,倍频光功率 0.08 mW。

对应不同的聚焦透镜,在相同的基波功 率下,所得到的最大倍频光功率亦不同,见图 4。对短焦距透镜,晶体中束腰处的基波光功 率密度较高,但光束的发散角大,有效作用长 度很小,倍频转换效率较低。用长焦距透镜 聚焦时,虽能获得较长的有效作用距离,但 束半径大,不能达到较大的功率密度,因而 倍频效率亦较低。在本实验条件下,得到对 514.5 nm 光聚焦镜的最佳焦距为7 cm 左 右。



在固定透镜焦距及位置时,改变晶体与 透镜的相对距离,倍频光功率亦随之改变,见 图 5。当晶体位于基波光束的光腰位置时, 得到的倍频光功率最大,晶体离开这一位置 时,由于基波束径增大,倍频效率降低。倍频 效率的变化在束腰两侧基本对称,这与高斯 光束的束半径在束腰两侧的对称性一致。

实验发现,晶体处于相位匹配角时,在基 波功率不变的情况下,倍频光功率随时间下 降,最后达到一个稳定值,且功率衰减到原功 率一半的时间τ与所用基波会聚透镜的焦距



有关,即与基波光功率密度有关,见图 6。倍 频光功率下降后,调节晶体对于入射光的φ 角(方位角)可使光功率回复到下降前的最高 值,而作θ角(天顶角)的调节则不能使功率回 升。停止基波光对晶体的照射,经过一段时 间后重新照射,亦可获得原最高倍频光功率。 这一现象表明,尿素晶体的折射率在高温时 有微小的变动。在温度升高后,晶体在 *x* 方 向和 *y* 方向的折射率存在差别,即尿素晶体 由单轴晶体变为双轴晶体。

三、讨 论

图 4 的结果可以推知, 若有 3 W 的基波

. 480 .

光功率,则可获得约1.5mW的倍频光,但 这仍低于 ADP 晶体或 KDP 晶体在90°相 位匹配时的转换效率^[4,5]。由于尿素晶体只 能采用角度相位匹配,且尿素晶体对o光和 e光折射率的差值较大,倍频光束和基波光 束的离散角较大,难以获得较长的有效作用 距离。在我们实验中,有效作用距离小于 2mm。用 ADP 晶体90°温度相位匹配时, 有效作用距离可达76mm^[6]。因此,虽然尿 素晶体有很高的非线性系数,在基波光功率 较低时,一般难以获得高的倍频转换效率。只 有当基波光波长为470nm 左右时,才有可 能得到较高的转换效率。因此尿素晶体较适 合于功率较高的脉冲激光倍频。

实验中基波光为基模,但得到的倍频光 斑为椭圆形。短半轴对应于θ角变化的方 向,且随着基波光会聚透镜的焦距的减小而 长短轴之比增大。这一结果表明尿素晶体倍 频角度相位匹配的容许角较小,基波光束经 锐聚焦后使倍频光束产生非对称性。但由于 基波光聚焦后可提高转换效率,因此,适宜的 方法是将基波光束经扩束望远镜收小后再聚 焦以减小会聚角。但这一方法易引进较高的 光损耗,降低了基波光的功率。

尿素晶体比 ADP 晶体更易 潮 解,因此 要采用光损耗小的防潮技术才能得到较好的 倍频效果。

参考文献

- [1] B. J. Jain, T. K. Gustafson; IEEE J. Quant-Electr., 1976, QE-12, 555.
- [2] K. Kato; IEEE J. Quant. Electr., 1980, QE-16, 810.
- [3] J. M. Halbout et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1979, QE-15, 1176.
- [4] R. J. Jain, T. K. Gustafson; IEEE J. Quant. Electr., 1973, QE-9, 859.
 - [5] M. W. Dowlay, E. B. Hodges; *IEEE J. Quant. Electr.*, 1968, **QE-4**, 552.
 - [6] 顾原岗等; «中国激光», 1984, 11, No. 10, 628.



图 4 晶体检波器测得的辐射波形

(a) 铁环波荡器,引导磁场 10 kG,空心柱状电子束,高通滤波器截止波长 10mm, y 轴 0.5 V/div;
(b) 同上,但截止波长减小到 6mm; (c) 同(a),但引导磁场为 4 kG,无高通滤波器

值。

为了从另一角度判断辐射的性质,我们 穿插总体实验做了大量的对比实验,即在除 去出激光所必需的任一条件(电子束不工作, 或波荡场取0,或引导磁场取0)下测试能量 及波形。发现所有这些场合,能量读数均为 零,示波器波形均为类似于图 4(b)、(c)的噪 声扫描线。正如美国海军实验室 Jackson 等 人指出^[4],这种对比实验表明我们获得的辐 射是相干超辐射放大模式。因为单纯的自发 辐射功率仅数十 mW,比相干超辐射小约 8 个数量级。

本所谢培良同志及上海无线电26厂李 明光同志提供了部分测试设备, 谨致谢意。

 H. Knoepfel; "Pulsed High Magnetic Fields", North-Holland Publishing Co., 1970.

老文献

- [2] T. S. Laverghetta; "Microwave Measurements and Techniques", Artech, 1976.
- [3] K. L. Felch et al.; IEEE. J. Quant. Electr., 1981, QE-17, 1354.
- [4] R. H. Jackson et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1983, QE-19, 346.